# © 2009 р. У. Піч<sup>1</sup>, А.В. Давидок<sup>1</sup>, І.М. Фодчук<sup>2</sup>, Н.В. Пашняк<sup>1</sup>, Т.А. Каземірський<sup>2</sup>, Р.А. Заплітний<sup>2</sup>, І.І. Гуцуляк<sup>2</sup>, О.Ю. Бончик<sup>3</sup>, Г.В. Савицький<sup>3</sup>, І.І. Сиворотка<sup>3</sup>, І.П. Яремій<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Університет Зігена, Зіген, Німеччина

<sup>2</sup>Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна <sup>3</sup>Інститут прикладних проблем механіки та математики НАН України, Львів, Україна <sup>4</sup>Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, Івано-Франківськ, Україна

# ВПЛИВ ІМПЛАНТАЦІЇ ІОНАМИ АЗОТУ НА СТРУКТУРНІ ЗМІНИ У ЗАЛІЗО-ІТРІЄВИХ ГРАНАТАХ ЛЕГОВАНИХ ЛАНТАНОМ

Методами високороздільної Х-променевої дифрактометрії проведені дослідження структурних змін у приповерхневих шарах епітаксійних плівок залізо-ітрієвих гранатів  $Y_{2,95}La_{0,05}$  Fe<sub>5</sub>O<sub>12</sub> після високодозової імплантації іонів азоту. Встановлено хід структурних перетворень після опромінення іонами азоту кристалів  $Y_{2,95}La_{0,05}$ Fe<sub>5</sub>O<sub>12</sub> через вибір відповідних моделей дефектної структури, що містять кілька типів домінуючих мікродефектів та певним чином розподіленого порушеного поверхневого шару.

The investigations of structural changes in epitaxial films of iron-yttrium garnet  $Y_{2,95}La_{0,05}$  Fe<sub>5</sub>O<sub>12</sub> after high dose ion implantation with nitrogen ions were performed using X-ray diffraction methods. The behaviour of structural transformations after irradiation of crystals  $Y_{2.95}La_{0.05}Fe_5O_{12}$  by the nitrogen ions was established by means of choice of the proper models of defect structure that contain several types of dominant micro defects and definitely distributed surface damaged layer.

Завдяки іонній імплантації як багатоцільовому методу модифікації поверхневих шарів в епітаксіних плівках залізо-ітрієвих гранатів (ЗІГ) Y<sub>295</sub>La<sub>005</sub>Fe<sub>5</sub>O<sub>12</sub> можна реалізувати нові структурні стани, які важко або неможливо отримати в звичайних об'ємних магнітних кристалах. При аналізі процесів, що відбуваються при імплантації іонів в такого роду об'єкти, виникають деякі характерні особливості, пов'язані з радіаційним дефектоутворенням в багатокомпонентних гетероепітаксійних плівках, у порівнянні з масивними напівпровідниками. Ці особливості пов'язані з наявністю в гетероструктурі полів пружних деформацій, зумовлених відмінністю періодів ґраток плівки і підкладки, та існуванням кількох кристалографічних і магнітних підграток. У ряді випадків слід також враховувати трансляцію елементарної комірки гранату з кубічної в ромбоедричну за рахунок невідповідності сталих ґраток деформованого та непорушеного шарів [1].

Для модифікації поверхні епітаксійних шарів  $Y_{2.95}La_{0.05}Fe_5O_{12}$  застосована високодозова імплантація іонів азоту ~ $10^{18}$  іон/см<sup>2</sup> при енергії E=50 кеВ. Для аналізу особливостей розсіяння X-променів у поверхневих шарах в комплексі використані взаємодоповнюючі методи дво- та багатокристальної високороздільної дифрактометрії, методи чисельного моделювання процесів динамічного розсіяння X-променів, атомно- силової мікроскопії.

### 1. Об'єкти досліджень

Епітаксійні плівки ферогранатів номінального складу Y<sub>3-x</sub>La<sub>x</sub>Fe<sub>5</sub>O<sub>12</sub> вирощувались у НВП "Карат" (Львів) методом ізотермічної рідинофазної епітаксії з переохолодженого розчину гранатоутворюючих компонент (La<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> та Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) в розплаві розчинника на горизонтальну підкладку (111) Gd<sub>3</sub>Ga<sub>5</sub>O<sub>12</sub>, яка обертається [2]. Основою розчинника була евтектична композиція PbO + 15,6 мол%  $B_2O_3$ . Процеси вирощування проводились у температурному діапазоні 940÷950°С при швидкості росту плівок 0,35 мкм/хв. Підкладка в процесі росту оберталась навколо екваторіальної осі зі швидкістю 60-90 об/хв. Іони La<sup>3+</sup>, які мають більший іонний радіус у порівнянні з іонами Ү3+, вводились у плівку для зменшення різниці параметрів кристалічної гратки плівки та підкладки (для Gd<sub>3</sub>Ga<sub>5</sub>O<sub>12</sub>

*a*=12,383 Å, для Y<sub>2.95</sub>La<sub>0.05</sub>Fe<sub>5</sub>O<sub>12</sub> *a*=12,376 Å).

Енергія імплантації іонів *E*=50 кеВ, доза опромінення і товщини плівок: №1 – *D*=5,0·10<sup>18</sup> іон/см<sup>2</sup>, *h*=21,9 мкм; №2 – *D*=1,5·10<sup>18</sup> іон/см<sup>2</sup>, *h*= 76,4 мкм; №3 – *D*=0,5·10<sup>18</sup> іон/см<sup>2</sup>, *h*=21,9 мкм.

Параметри епітаксійних плівок ферогранатів, такі як намагніченість насичення  $4\pi Ms$ , ширина лінії  $2\Delta H$  феромагнітного резонансу (ФМР), поле анізотропії залежать від розподілу катіонів між підгратками, присутності кисневих вакансій, іонів двовалентного заліза, механічних напружень [3]. Ширина лінії феромагнітного резонансу вимірювалася з використанням методу локального збудження резонансного поглинання (метод "магнітної ями") на частоті 3,1 ГГц. Деякі виміряні параметри наведені в таблиці 1.

Таблиця 1. Характеристики епітаксійних плівок

v	Ιa	Εa	$\cap$
12	$95La_0$	05565	$\mathbf{U}_{12}$

2.75 - 0.05 - 5 - 12				
Попомотри	Доза опромінення $D$ , ioн/см <sup>2</sup>			
Параметри	$5,0.10^{18}$	$1,5 \cdot 10^{18}$		
Товщина, мкм	21,9	76,4		
Температура росту, °С	942	950		
Мольне відношення	19	10		
<u>Y<sub>2</sub>O<sub>3</sub> в розплаві</u>				
$La_2O_3$				
Ширина ліні ФМР, 2 <i>ΔН</i>				
Область без імплантації	2,6	1,1		
Імплантована области	1 27	1.08		

Після високодозової іонної імплантації відбулося значне покращення намагніченості насичення плівок (таблиця 1) – півширина лінії феромагнітного резонансу зменшилась для першої плівки більш ніж у 2 рази, для другої – на 15% і залежить від мольного співвідношення компонент.

Ширина лінії феромагнітного резонансу визначає електромагнітні втрати надвисокочастотного пристрою і, чим менший параметр  $2\Delta H$ , тим меншими є електромагнітні втрати [3].

## 2. Структурні зміни поверхневих шарів Y<sub>2.95</sub>La<sub>0.05</sub>Fe<sub>5</sub>O<sub>12</sub> плівок після імпланації іонів азоту

Для модифікації поверхні залізо-ітрієвих гранатів (Y2.95La0.05Fe5O12) використовується, як правило, високодозова імплантація іонів  $(D>1\cdot10^{15}$  іон/см<sup>2</sup>), в результаті якої може утворитися прихований або суцільний до поверхні аморфізований шар [4- 6]. Виникнення прихованого аморфного шару найбільш ймовірне при імплантації іонів з малими і високими енергіями, хоча на характеристики такого шару впливає також доза, швидкість набору дози і температура імплантації [7].



гис. 1. Розрахункові залежності енергетичних втра іона  $N^+$  у La:ЗІГ: 1 – ядерні, 2 – електронні.

Для моделювання процесу іонної імплантації використовувався програмний пакет *SRIM* -2008 [8]. У моделі, за якою працює дана програма, передбачається, що дефектоутворення відбувається тільки внаслідок передачі енергії імплантантом у ядерну підсистему мішені в результаті пружних зіткнень.

На основі теорії пружних зіткнень з використанням програмного продукту *SRIM* - 2008 досліджено процеси взаємодії іонів азоту з атомами кристалічної гратки у плівках  $Y_{2.95}La_{0.05}Fe_5O_{12}$ після високодозової імплантації. Вважалося, що дефектоутворення відбувається тільки внаслідок передачі енергії іонами N<sup>+</sup> в ядерну підсистему мішені внаслідок пружних зіткнень. Підпорогові ефекти – структурне розупорядкування при непружних процесах збудження та іонізації електронних оболонок не враховувалися.

Для монокристалу ЗІГ значення порогової енергії зміщення  $E_d$  за даними [9] становлять: для іонів кисню –  $\approx$ 30 еВ, для іонів Fe<sup>3+</sup> – 56 еВ, Y<sup>3+</sup> – 66 еВ.

Розраховані за допомогою пакету *SRIM*-2008 [8] залежності втрат енергії іоном на одиницю шляху  $(dE/dx)_n$  і  $(dE/dx)_e$  від енергії імплантованих іонів наведені на рис. 1.

При енергії 50 кеВ електронні енергетичні втрати становлять ~67,2% (28,5 еВ/Å), ядерні – ~32,8% (13,9 еВ/Å). Виходячи з того, що втрати енергії іоном на одиницю шляху однакові (в припущенні, що обидва процеси незалежні один від одного) для ЗІГ  $N_0$ =8,44·10<sup>22</sup> ат/см<sup>3</sup>,  $S_n$ =3,9·10<sup>-14</sup> см<sup>-2</sup>,  $S_e$ =8,0·10<sup>-14</sup> см<sup>-2</sup>.

$$S_{e, n} = \frac{1}{N_0} \left( \frac{dE}{dx} \right)_{e, n}, \ \frac{dE}{dx} = N_0 [S_n(E) + S_e(E)],$$

де  $S_n(E)$  і  $S_e(E)$  – переріз ядерного і електронно-

го гальмування відповідно,  $N_0$  – кількість атомів в одиниці об'єму мішені [10].

Передана іоном у ядерну підсистему матриці енергія по всій довжині треку в багатьох випадках досягає значень, необхідних для розвитку каскаду вторинних зміщень.

Статистична обробка результатів моделювання повного каскаду зіткнень показала, що приблизно 50% каскадів вторинних зміщень складається із одного вибитого атома матриці, ≈15% каскадів вторинних зіткнень складається із двох атомів матриці, ≈8% – з трьох і т.д. (рис. 2). Виявляється, що 0,2% каскадів вторинних зміщень складаються із 25 вибитих атомів матриці (трапляються також каскади із 70-100 вибитих атомів).



Рис. 2. Ймовірність утворення каскадів вторинних зміщень атомів матриці із різною кількістю іонів n при опроміненні плівок La: Y<sub>3</sub>Fe<sub>5</sub>O<sub>12</sub> іонами азоту.

При моделюванні процесу іонної імплантації було отримано розподіл по глибині величини ядерних енергетичних втрат іона-імплантанта, а також розподіли імплантованих іонів N+ та зміщених іонів матриці, які представлено на рис. 3 і рис. 4.

На рис. 4, максимум профілю впроваджених іонів  $N^+$  зміщений в глибину відносно положення максимуму профілю дефектів на величину ~300Å. Це пов'язане з тим, що іони-імплантанти на кінцевих етапах руху мають недостатню для генерації дефектів енергію, тобто їх зіткнення з атомами матриці приводять лише до посилення коливань останніх.

При іонній імплантації легкими іонами (He<sup>+</sup>, B<sup>+</sup>) середніх енергій утворюються, в основному, точкові дефекти. Порівнюючи кількість теоретично обчислених дефектів (вважаючи, що 98% з них відразу рекомбінують) для дози, при якій порушений шар є повністю Х-променево аморфним (додаткова осциляційна структура на кривій дифракційного відбивання від порушеного шару відсутня), можна стверджувати, що Х-







Рис. 4. Профілі розподілу іонів-імплантантів (1 – нормовано до дози) та зміщених іонів матриці (2, 3, 4 5 – кисню, заліза, ітрію і лантану відповідно) в La: $Y_3Fe_5O_{12}$  при імплантації іонами N<sup>+</sup>, E = 50 кеВ.

променево аморфний стан настає при зміщенні приблизно кожного 10 атома. При цьому максимальний ступінь розупорядкування, розрахований за допомогою програми *SUSPRE*, складає приблизно 65%.

Аналогічні розрахунки, проведені для іонів N<sup>+</sup> середніх енергій, показали, що Х-променево аморфним приповерхневий порушений шар стає при зміщенні кожного 400-го атома матриці при ступеню розупорядкування ~20%. Напевно вказана відмінність для легких і середніх за масою іонів пов'язана із утворенням каскадів вторинних зіткнень, які спричинюють значне руйнування кристалічної гратки плівок La:Y<sub>3</sub>Fe<sub>5</sub>O<sub>12</sub> і не враховуються у програмі *SUSPRE*.

У результаті того, що кожний окремий іон, в середньому, привносить у приповерхневий шар енергію більшу за критичну, відбувається утворення окремих приповерхневих аморфних областей. Зі зростанням величини дози відбувається їх накопичення і злиття з досягненням критичної дози з утворенням суцільної приповерхневої аморфної області. Крім того, у результаті стимульованої градієнтом напруг дифузії точкових радіаційних дефектів із об'єму до поверхні буде відбуватися "підживлення" і розвиток поверхневої аморфної зони, і її просування вглиб плівки.

З ростом дози опромінення (>  $1 \cdot 10^{14}$  см<sup>-2</sup>) додаткова осциляційна структура зазнає характерних для процесу аморфізації приповерхневого порушеного шару змін: зменшується її інтенсивність і зникають осциляції. Максимальна деформація при цьому все ж зростає і при дозі D= = $6 \cdot 10^{14}$  см<sup>-2</sup> дорівнює ~1,5%. Незначне збільшення дози опромінення приводить до зникнення додаткової осциляційної структури (D= $8 \cdot 10^{14}$  см<sup>-2</sup>), що пояснюється переходом порушеного шару у Х-променево аморфний стан.

Моделювання процесу іонної імплантації за допомогою програми *SRIM*, при бомбардуванні поверхні 10000 іонів N<sup>+</sup> відбувається 2151 випадок вибивання атомів матриці з поверхні плівки. При цьому у 59% випадків вибивається кисень, 28% – залізо, 13% – ітрій, <1% – лантан. Товщина розпиленого з поверхні плівки шару буде помітна (перевищувати 25Å) тільки при дозах вищих  $1 \cdot 10^{17}$  см<sup>-2</sup>, а її залежність від дози імплантації наведена на рис. 5.

Значні радіаційні дефекти у порушеному шарі будуть понижувати енергію дефектоутворення атомів мішені і їх поверхневу енергію зв'язку.

У результаті досліджень показано, що при енергії іонів азоту Е=50 кеВ найбільш ймовірним є процес генерації френкелівських пар (~65%). Розвиток каскаду з двох атомів віддачі ~21%, трьох – 8%, чотирьох – 4%. Середній об'єм розупорядкованої ділянки V~19Å<sup>3</sup>. Переважаючими в процесі імплантації є електронні енергетичні втрати ~70%, що становить з умов експерименту ~26 eB/Å, середня довжина проективного пробігу іонів N<sup>+</sup> складає ~845 Å. Максимуми зміщених іонів матриці і ядерних енергетичних втрат співпадають і становлять ~550 Å [6, 11]. Кількість утворених вакансій на іон ~182, ефективний радіус дефекту r<sub>eff</sub>=0,79Å ±0,2Å. Впроваджені в гратку  $Y_{2.95}La_{0.05}Fe_5O_{12}$  іони  $N^+$  і спричинені ними радіаційні дефекти – вакансії підлягають гаусівському розподілу.

З ростом дози ймовірність того, що новоутворені компоненти пар Френкеля опиняться в ділянці нестійкості інших дефектів зростає і збільшення концентрації радіаційних дефектів обмежується анігіляцією зміщених атомів на вже існуючих вакансіях. Концентрація радіаційних



Рис. 5. Залежність товщини розпиленого з поверхні плівки шару від дози опромінення.

дефектів при цьому описується виразом [12]:

$$n_d(D) = \frac{1}{V_H \left(1 - \exp\left[-N\sigma_d V_H D\right]\right)}, \qquad (1)$$

де  $V_H$  – об'єм ділянки нестійкості, N – концентрація іонів мішені, D – доза опромінення,  $\sigma_d$  – переріз.

Оскільки для пружного ізотропного середовища зміна об'єму кристалу є пропорційною до концентрації утворених сферичносиметричних дефектів, то відносна деформація поверхневих шарів  $\Delta d/d_{\rm max}$  визначається як

$$\left(\Delta d \,/\, d\right)_{\max} = \overline{V} \cdot n(D)\,,\tag{2}$$

де  $\overline{V}$  – ефективний об'єм дефекту (усереднений за дефектами усіх типів), n – концентрація дефектів у порушеному шарі. Тоді із співвідношень (1) і (2) можна отримати значення ефективного радіусу дефекту  $r_{eff}$ =0,819Å при D= =5 $\cdot 10^{17}$  см<sup>-2</sup>.

Отже, навколо треку кожного імплантованого іона утворюється область із сильно порушеною кристалічною структурою, яка може містити як прості дефекти типу міжвузлових атомів і вакансій, так і їх англомерати.

Профіль утворених іонною імплантацією радіаційних дефектів не співпадає з профілем механічних напружень, який зсунутий вглиб кристалу [13].

## 3. Структурні дослідження епітаксійних плівок Y<sub>2,95</sub>La<sub>0,05</sub> Fe<sub>5</sub>O<sub>12</sub> після високодозової імплантації іонів N<sup>+</sup>

За допомогою дво- і три кристальної дифрактометрії отримано криві дифракційного відбивання (КДВ) і картини розподілу інтенсивності для (444) і (888) рефлексів Си $K_{\alpha}$ -випромінювання (рис.6-9). Експериментальні дослідження було проведено в на установці *XRD* 3003 *PTS* в університеті міста Зіген (Німеччина).



Рис.6. Мапи розподілу інтенсивності в області вузла (444): a) D=5·10<sup>18</sup> іон/см<sup>2</sup>, б) D=0,5·10<sup>18</sup> іон/см<sup>2</sup>; в) D=1,5·10<sup>18</sup>.



a) 6) B) Puc.7. Мапи розподілу інтенсивності в області вузла (888) : a)  $D=5\cdot10^{18}$  ioh/cm<sup>2</sup>; b)  $D=0,5\cdot10^{18}$  ioh/cm<sup>2</sup>; b)  $D=1,5\cdot10^{18}$ .

Для визначення і уточнення товщинного профілю деформацій з КДВ використано комбінацію двох підходів, які грунтуються на підгонці кривих гойдання – це числовий розв'язок рівнянь Такагі [14-19] та теорії, розвинутої у праці [20]. У якості першого наближення розподілу деформацій за товщиною вибрано розподіл іонів азоту за даними програми *SRIM*.

На отриманих деформаційних профілях максимальне значення напруг ( $\Delta d/d=-3,2\cdot10^{-4}$ ) для еталону №1 спостерігається біля поверхні зразка.

Для розрахунку товщинного розподілу деформації і концентрацій домінуючих дефектів у приповерхневих областях шарів використано рівняння Такагі-Топена і узагальнену динамічну теорію розсіяння Х-променів. Розрахунки коефіцієнтів Фур'є-поляризуємості проводилося за алгоритмом розробленим в [21].

Варто зауважити, що для даної і вищих доз імплантації додаткові напливи спостерігаються з обидвох боків від головного брегтівського піку "ідеальної" частини плівки, що може свідчити про наявність як додатніх, так і від'ємних деформацій у порушеному шарі. Від'ємні деформації якраз і можуть бути пов'язані з вибиванням атомів матриці з поверхні плівки. Виходячи з того, що при даній дозі опроміннення розсіяння поверхні ще не є значним (~125 Å), і, відповідно, максимально деформований шар в глибину зміститься практично на таку саму відстань, основний внесок в деформацію при даній дозі очевидно будуть вносити впроваджені іони азоту. Підтвердженням цього можуть слугувати результати моделювання за програмою *SRIM*, згідно яких на глибині ~900 Å (максимум розподілу іонів імплантантів) при даній дозі на кожен атом матриці припадає 0,65 іонів азоту.

При переході до дози опромінення  $1,5 \cdot 10^{18}$  см<sup>-2</sup> відбувається розсіяння порушеного шару товщиною ~400 Å, зміщення максимуму дефектів у ділянку із максимальною концентрацією азоту і остаточна аморфізація всього деформованого (в тому числі і через наявність впроваджених іонів N<sup>+</sup>) порушеного шару. Це підтверджується зникненням додаткової осциляційної структури на КДВ, отриманих від опромінених вказаною дозою зразків (рис.8б).

Перехід до дози 5·1018 см<sup>-2</sup> приводить до повного розпилення порушеного шару (~1300 Å згідно рис. 5) і просування деформованої області у глибину плівки. Це, в свою чергу, приводить до виникнення деформацій на глибинах 1500–3000 Å, і проявляється на КДВ у вигляді додаткових напливів біля головного бреггівського піка "ідеальної" частини плівки. На відміну від першого етапу деформації приповерхневого шару (1·10<sup>13</sup> – 1·10<sup>14</sup> см<sup>-2</sup>), коли імплантація відбувалася по

всій товщині порушеного шару, при дозах більших  $1,5 \cdot 10^{18}$  см<sup>-2</sup>, просування максимуму розподілу іонів N<sup>+</sup> та генерованих ними дефектів відбувається послідовно, в міру розпилення поверхні. На експериментальних КДВ від імплантованих дозою  $5 \cdot 10^{18}$  см<sup>-2</sup> зразків також спостерігаються напливи з обох боків від головного бреггівського піка "ідеальної" частини плівки.

Для детальнішого вивчення структури припо-

верхневих шарів плівок La:Y<sub>3</sub>Fe<sub>5</sub>O<sub>12</sub> було проведено X-променеві дифрактометричні дослідження із використанням  $\omega/2\theta$ -сканування та  $\omega$ сканування (трикристальний спектрометр), а також вимірювання мап оберненого простору. Як і очікувалося, спостерігається задовільна кореляція між  $\omega/2\theta$ - і  $\omega$ -кривими із мапами оберненого простору в околі відповідних вузлів оберненої гратки.



Рис. 8. Теоретичні та експериментальні криві гойдання і розподіли деформацій: а)  $D=0,5\cdot10^{18}$  іон/см<sup>2</sup>; б)  $D=1,5\cdot10^{18}$  іон/см<sup>2</sup>; в)  $D=5\cdot10^{18}$  іон/см<sup>2</sup>.



Рис. 9. Теоретичні і експериментальні криві гойдання і розподіли деформацій еталонних плівок: відбивання (444), h = 76,4 мкм (a), h = 21,9 мкм (б); відбивання (888) h = 76,4 мкм (в), h = 21,9 мкм (г).

Науковий вісник Чернівецького університету. 2009. Випуск 438. Фізика. Електроніка.

Однак варто відзначити, що  $\omega/2\theta$  КДВ, отримані в режимі трикристальної спектрометрії і двокристальної із широко відкритим вікном перед детектором суттєво відрізняються. На трикристальних КДВ відсутні інтенсивні напливи з обох боків головного бреггівського піка "ідеальної" частини плівки. Для пояснення такої невідповідності необхідно розглянути особливості сканування для вказаних випадків.

При отриманні двокристальної КДВ із широко відкритим вікном перед детектором відбувається інтегрування інтенсивності по дузі, нахиленій відносно КОП під деяким кутом. На КОП як імплантованих так і не імплантованих зразків з товщиною 21,9 мкм біля основного максимуму спостерігаються два сателіти. При інтегруванні інтенсивності по дузі спочатку фіксується один сателіт, потім головний брегівський пік, а тоді інший сателіт. Різна відстань між напливами також пов'язана із напрямом сканування і узгоджується із вище вказаним поясненням.

Отже, напливи обох боків головного брегівського піка "ідеальної" частини плівки на двокристальній КДВ із широко відкритим вікном перед детектором пов'язані не із нормальною (перпендикулярною до площини плівки) деформацією приповерхневого шару плівки.

Визначений на основі зіставлення розрахованих і експериментальних кривих гойдання (рис.8) профіль деформації за товщиною для плівки №1 має різкий перегин в області нуля деформацій і спостерігається параболічна залежність для від'ємних деформацій. Величина від'ємної деформації на поверхні плівки  $\Delta d/d = -3,22 \ 10^{-4}$ , товщина дисперсного поверхневого шару  $z_0 \sim 1510$  Å; область додатних деформацій знаходиться на глибині *z*<sub>max</sub>=2200 Å, максимальна деформація  $\Delta d/d_{\text{max}} \approx 1,82 \ 10^{-4}$ , півширина *W*=600 Å, протяжність z<sub>1</sub>=2850 мкм, характер кривої експоненційний. При *D*=1,5·10<sup>18</sup> іон/см<sup>2</sup>:  $\Delta d/d$ =-0,492 10<sup>-5</sup>, *z*<sub>0</sub> ~1400 Å,  $z_{\text{max}}$ =2200 Å,  $\Delta d/d_{\text{max}}$ =7,25 10<sup>-5</sup>, W=600 Å, *z*=3000 мкм, характер кривої параболічний. При  $D=5.10^{18}$  ioн/см<sup>2</sup>:  $\Delta d/d=-3.76 \ 10^{-4}$ ,  $z_0\sim1550$ Å,  $z_{\text{max}}$ =2200 Å,  $\Delta d/d_{\text{max}}$ =2,65 10<sup>-4</sup>, W=650 Å,  $z_l$ = =3300 мкм.

З отриманих розподілів деформації випливає, що на формування КДВ значно впливає неоднорідний розподіл легуючої компоненти за товщиною, а також деформації невідповідності на границі розділу плівка-підкладка. Напруги, які виникають в каскадах атомних зіткнень, є джерелами дислокаційних петель Франка-Ріда з їх наступним рухом вглиб кристалу. Дислокаційні петлі можуть з'являтися і як результат взаємодії точкових дефектів, в основному вакансій, причому стійкі вакансійні петлі мають розмір ~1 нм, а ймовірність утворення петель на один каскад знаходиться в межах  $0,1\div5$  [21-23]. Швидкість рекомбінації дефектів із збільшенням дози опромінювання зростає і пропорційна, частіше всього, їх концентрації, яка із зростанням дози також неперервно зростає.

Товщина збудженого шару суттєво перевищує проективний пробіг іонів, а його властивості визначаються процесами, які відбуваються в зміненому, і, навіть, в емісійному шарах. В збудженому шарі відбувається утворення напруг і процеси радіаційно-стимульованої дифузії.

# 4. Атомно-силова мікроскопія епітаксійних плівок Y<sub>2,95</sub>La<sub>0,05</sub>Fe<sub>5</sub>O<sub>12</sub> модифікованих іонною імплантацією.

Для кожного із досліджуваних об'єктів на рис. 10а приведено АСМ зображення характерних для них локальних областей розміром 1×1 мкм<sup>2</sup>. Ділянки поверхні кожної із плівок характеризуються своїми параметрами рельєфу і ступенем структурного розупорядкування.

Для зразка з дозою опромінення  $D_1=0,5\cdot 10^{18}$ іон/см<sup>2</sup> фрагмент профілю поверхні y(x) – аперіодичний (рис. 10б), квазіперіод ~0,12 мкм. При дозі опромінення  $D_2=1,5\cdot 10^{18}$  іон/см<sup>2</sup> фрагмент профілю поверхні y(x) також аперіодичний, квазіперіод ~0,18 мкм.

Для зразка з дозою опромінення  $D_3 = 5,0 \cdot 10^{18}$ іон/см<sup>2</sup> фрагмент профілю поверхні y(x) характеризується більшою періодичністю, квазіперіод ~0.3 мкм. Наявність значної неорієнтованої частини в розподілі інтенсивності фур'є-образу (рис. 10в) вказує на ближній порядок в системі, тобто утворення аморфного шару, товщина якого зростає із збільшенням дози опромінення. Водночас для зразків з дозами опромінення  $D_1$  і  $D_2$  в центрі фур'є-образу спостерігається нахилена смуга під кутами 103° і 108°, що добре видно на індикатрисах розподілу інтенсивності фур'є-образів (рис. 10г). Отже, для зразка з дозою D<sub>1</sub> нерівності орієнтовані під кутом 13°  $(103^{\circ}-90^{\circ}=13^{\circ})$ , а для зразка з дозою  $D_2$  нерівності орієнтовані під кутом 18°.

Інший параметр поверхні зразка – коефіцієнт напряму текстури (*S*<sub>tdi</sub>) визначає, наскільки





Рис.10. АСМ зображення ділянок поверхні (1×1 мкм<sup>2</sup>) для доз імплантації  $D_1=0,5\cdot10^{18}$ ,  $D_2=1,5\cdot10^{18}$  і  $D_3=5,0\cdot10^{18}$  іон/см<sup>2</sup> (а), фрагменти профілю y(x) поверхні відповідних ділянок (б), низькочастотні фрагменти фур'є-образів ділянок поверхні (в), індикатриси фур'є-образів (відповідні коефіцієнти напряму текстури  $S_{td1}=0,81$ ;  $S_{td2}=0,79$ ;  $S_{td3}=0,92$ ) (г).

домінує переважаючий напрям текстури на зображенні. Визначається Stdi як середнє значення індикатриси, поділене на максимальне значення. За визначенням значення S<sub>tdi</sub> лежить в діапазоні від 0 до 1. Для поверхні лише з одним переважаючим напрямком значення S<sub>tdi</sub> близьке до 0, а для багатьох рівнозначних текстур S<sub>tdi</sub> наближується до 1. Відповідно до значень коефіцієнту напряму текстури Stdi (рис. 10г) отримано результати, аналогічні до результатів аналізу індикатрис: для зразків з дозами D<sub>1</sub> і D<sub>2</sub> спостерігається слабка орієнтація нерівностей поверхні. Для зразка з дозою D<sub>3</sub> напрям переважної орієнтації нерівностей відсутній. Аналіз отриманих результатів показує, що значення Stdi пропорційні до ступеня аморфізації поверхні.

Найбільші зміни рельєфу поверхні, як і очікувалолся, характерні для плівки №3, опроміненої найбільшою дозою іонів; поверхня – неоднорідна, спостерігаються характерні локальні розупорядковані області з перепадом висот до 20 нм середніми розмірами ~0,15 мкм.

#### Висновки

1. Методами високороздільної Х-променевої дифрактометрії проведені дослідження структурних змін у приповерхневих шарах епітаксійних плівок Y<sub>2,95</sub>La<sub>0,05</sub>Fe<sub>5</sub>O<sub>12</sub>, після високодозової імплантації іонів азоту. Дослідження проводилися на високороздільному дифрактометрі *XRD* 3003 *PTS*.

2. Розраховано фізичні параметри, які необхідні для розрахунку кривих гойдання і мап розподілу інтенсивності для співставлення з експериментальними вимірами.

3. Визначено товщину порушеного шару, середнє, середнє квадратичне зміщення атомних площин і ступінь аморфізації приповерхневих шарів підкладки. Отримано розподіли деформаційних полів на границі розділу порушений шар – підкладка.

За даними АСМ найбільші зміни рельєфу по-

верхні характерні для плівки № 3, опроміненої найбільшою дозою іонів. Поверхня неоднорідна, спостерігаються характерні локальні розупорядковані області з перепадом висот до 20 нм та середніми розмірами ~ 0,15 мкм.

4. Застосування іонної імплантації для модифікації структури і властивостей залізо-ітрієвих структурах ускладнено процесами, які пов'язані з радіаційним дефектоутворенням в багатокомпонентних гетероепітаксійних плівках в порівнянні з масивними напівпровідниками. Це пов'язано з наявністю у гетероструктурі поля пружних деформацій, зумовленого розходженням сталих граток плівки і підкладки та існуванням кількох кристалографічних і магнітних підграток.

#### СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

- Остафійчук Б.К., Яремій І.П., Кравець В.І., Клюка С.Я., Яремій С.І. Вплив кристалічної структури епітаксійних плівок ЗІГ на профілі деформації // Фізика і хімія твердого тіла. – 2006. – 7, №3. – С. 436-441.
- Юр'єв С.О., Ніколайчук В.Й., Ющук С.І., Костюк П.С. Виготовлення і властивості шаруватих ферогранатових структур // Вісник ДУ Львівська політехніка. Елементи теорії та приклади твердо тільної електроніки. – 2000. – №393. – С. 37-40.
- Ющук С.І., Коцюбинський В.О., Юр'єв С.О., Яремій І.П. Вплив відпалу на магнітні властивості ферогранатових плівок // Фізика і хімія твердого тіла. – 2001. – 2, №4. – С. 735-739.
- Вильямс Дж.С. Ионная имплантация и лучевая технология – К.: Наукова думка, 1988.
- Двуреченский А.В., Каранович А.А., Рыбин А.В. Механизм дефектообразования в кристаллах при неупругом торможении высокоэнергетических ионов // ЖЭТФ. – 1995. – 107, вип.2. – С.493-503.
- Fabbri R. X-ray diffraction analysis of damage accumulation due to the nuclear energy loss of 50keV and 1-2.2 MeV B ions implanted in silicon / Fabbri R., Lulli G., Nipoti R. and Servidori M. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research. – 1993. – B80/81. P.624-627.
- Guzman A.M., Bauer C.L., Silvain J.F., Kryder M.H. The irradiation effects of ion implantation on magnetic garnets // Nucl. Instrum. and Meth. Phys. Res. – 1986. – B16, №2-3. – P. 230-236.
- Ziegler J. F., Biersack J.P., Littmark U. The Stopping and Range of Ions in Solids. – New-York :Pergamon Press, 1985.
- Довгый. Я.О., Китык В.И., Матковский А.О. Квантовомеханический подход к образованию дефектных состояний в гадолиний-галлиевых гранатах // ФТТ. – 1992. – 34, №4. – С. 1078-1087.
- 10. Риссел Х., Руге И. Ионная имплантация. М.: Наука, 1983.

- 11. *Мынбаев К.Д., Иванов-Омский В.И.* Легирование эпитаксиальных слоев и гетероструктур на основе HgCdTe // ФТП. 2006. **40**, №1. С.541-551.
- 12. Остафійчук Б.К., Яблонь Л.С., Коцюбинський В.О. Кристалічна і магнітна мікроструктура приповерхневих шарів монокристалічних плівок LaGa-заміщеного залізо-ітрієвого гранату імплантованих іонами F+ // Фізика і хімія твердого тіла. – 2004. – 5, №4. – С. 744-749.
- Vydyanath H.R., Abbott R.C., Nelson D.A. Mode of incorporation of phosphorus in Hg<sub>0.8</sub>Cd<sub>0.2</sub>Te // J.Appl.Phys. - 1983. - 54, №3. - P.1323-1331.
- Takagi S. A Dynamical theory of diffraction for a distorted crystal // J. Phys. Soc. Japan. 1969. 26, №5. – P. 1239-1253.
- 15. Афанасьев А.О., Фанченко С.С. Восстановлении профилей нарушений тонких приповерхностных слоев по рентгенодифракционным данным // Кристаллография. 1986. **287**, №6. С.1395-1399.
- 16. Пунегов В.И. Статистическая динамическая теория дифракции рентгеновских лучей на кристаллах с непрерывно изменяющимся по толщине параметром решетки // Кристаллография. – 1990. – 35, вып.3. – С.576-583.
- 17. Гончарский А.В., Колпаков А.В., Степанов А.А. Обратные задачи вычислительной диагностики нарушенных приповерхностных слоев кристаллов по рентгенодифракционным данным // Поверхность. 1986. №12. С. 72-86.
- Speriosu V.S, Wilts C.H. X-ray rocking curve and ferromagnetic resonanse investigations of ionimplanted magnetic garnet // J.Appl.Phys. – 1983. – 54, №6. – P.3326-3343.
- Афанасьев А.М., Александров П.А., Имамов Р.М. Рентгеновская структурная диагностика в исследовании приповерхностных слоёв монокристаллов. – М.: Наука, 1986.
- 20. Kyutt R.N., Petrachen P.V., Sorokin L.M. Strain Profiles in Ion-Doped Silicon Obtained from X-Ray Rocking Curves // Phys. status solidi A. – 1980. – 50. – P.381-389.
- 21. Кисловський Є.М., Оліховський С.Й., Молодкін В.Б., Остафійчук Б.К., Владімірова Т.П., Лень Є.Г. Визначення рентгенодифракційних параметрів монокристалів гранатів по кривих дифракційного відбиття // Металлофизика и новейшие технологи. – 2005. – 27, №2. – С. 217-231.
- 22. Остафийчук Б.К., Федорив В.Д., Кравец В.И., Василишин Б.В. Структура приповерхносного слоя феррит-гранатовой пленки, имплантированной ионами бора // Металлофизика и новейшие технологи. – 1995. – 17, №2. – С. 67-72.
- 23. Остафійчук Б.К., Будзуляк І.М., Яремій І.П., Яблонь Л.С. Структурні перетворення в La,Gaзаміщених ФІП, обумовлені дією лазерного опромінення // Фізика і хімія твердого тіла. – 2008. – 9, №1. –С.19-23.